

Актуальный перечень аналитического оборудования ЦКП ИФМ РАН и
вспомогательного технологического оборудования (2021 г.)

1.	Лазерно-плазменный источник рентгеновского излучения
2.	Сканирующий зондовый микроскоп Solver PRO-HV (НТ-МДТ)
3.	ИК-Фурье спектрометр BOMEM DA3.36
4.	ИК-Фурье спектрометр Vertex 80V (Bruker)
5.	Фурье-спектрометр Инфралюм ФТ-801
6.	Сканирующий электронный микроскоп Supra 50VP (Carl Zeiss)
7.	Измерительная система Talysurf CCI 2000 (Taylor)
8.	Вторично-ионный масс-спектрометр TOF-SIMS 5-100 (IONTOF)
9.	Установка реактивного ионного травления с источником индуктивно связанной плазмы PlasmaLab 80
10.	Сверхпроводящая магнитная система
11.	Анализатор спектра Agilent 4407B
12.	Двухлучевая система с высоким разрешением для исследования и подготовки образцов Neon-40 (Carl Zeiss)
13.	Цифровой осциллограф
14.	Стенд для измерения СВЧ характеристик джозефсоновских переходов
15.	Дифрактометр рентгеновский D8 Discover
16.	Лазерный генератор микро-изображений mPG101
17.	Станция ожижения гелия Cryomech LHeP18 с системой сбора газообразного гелия
18.	Генератор сигналов Agilent Technologies E8257D
19.	Атомно-силовой микроскоп Ntegra Prima
20.	Сканирующий мульти-микроскоп СММ-2000
21.	Вакуумная установка резистивного и электронно-лучевого испарения с холловским ионным источником Amod 206
22.	Автоэмиссионный просвечивающий электронный микроскоп LIBRA® 200MC
23.	Профилометр модели 130 (Протон-МИЭТ)
24.	Анализатор спектра Rohde&Schwarz FPC 1000
25.	Оптический рефлектометр KIWI-7221
26.	Комплект оборудования подготовки образцов Fischione для исследования методами просвечивающей электронной микроскопии
27.	Сканирующий электронный микроскоп EVO 10
28.	Комплект вакуумного оборудования с системой виброзащиты для вакуумного сканирующего зондового микроскопа
29.	Сканирующий зондовый микроскоп «Solver-P7LS»
30.	Аппаратно-программный комплекс электронной литографии ELPHY PLUS
31.	Система очистки образцов и рабочей камеры микроскопа с помощью кислородной плазмы
32.	Установка магнетронного напыления тонких пленок
33.	Установка для измерения вольт-амперных характеристик
34.	Установка совмещения и экспонирования для получения заданного рисунка микронного разрешения на плоских подложках методом фотолитографии
35.	Установки для термического напыления (металлов, диэлектриков, сверхпроводников, органических полупроводников)
36.	Установка для быстрой температурной обработки микроструктур AcuThermo AW 410 System
37.	Установка экспонирования контактной фотолитографии SUSS MJB4
38.	Стенд для измерения магнитооптических эффектов Керра и Фарадея в тонких

	магнитных плёнках
39.	Стенд ионно-пучкового травления
40.	Установка магнетронно-ионного напыления многослойных структур
41.	Установка магнетронного распыления
42.	Стенд рентгеновской спектроскопии для диапазона 0,8-200 нм
43.	Стенд спектральных измерений на основе лазерно-плазменного источника 4-50 нм